

绝对式光栅尺母尺刻划曝光系统

刘华¹, 卢振武¹, 熊峥^{1,2}, 王尧¹, 王鹤¹, 黄剑波¹, 谭向全¹, 孙强¹

1. 中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所 光电技术研发中心, 吉林 长春 130033;
2. 中国科学院大学, 北京 130049

Exposure optical system in lithographic main scale of absolute optical encoder

LIU Hua¹, LU Zhen-wu¹, XIONG Zheng^{1,2}, WANG Yao¹, WANG He¹, HUANG Jian-bo¹, TAN Xiang-quan¹, SUN Qiang¹

1. Optoelectronics Technology Center, Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130033, China;
2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 130049, China

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献](#)

[相关文章 \(5\)](#)

访问总数: 557094

版权所有 © 2012 《光学精密工程》编辑部

地址: 长春市东南湖大路3888号 邮编: 130033 E-mail: gxjmgc@sina.com

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发